② 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-9856

⑤Int. Cl. ⁵
C 07 C 317/22 315/04

識別記号

庁内整理番号 8217-4H **33**公開 平成 2 年(1990) 1 月12日

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

3発明の名称 新規なヒドロキシスルホンおよびその製造方法

②特 願 昭63-160464

②出 願 昭63(1988)6月27日

 ⑩発 明 者 大 西 孝 志

 ⑩発 明 者 鈴 木 繁 昭

 ⑩発明者 鈴木
 繁昭

 ⑩発明者 森
 俊樹

⑪出 願 人 株式会社クラレ

倒代 理 人 弁理士 本 多 堅

新潟県北蒲原郡中条町倉敷町 2 番28号 株式会社クラレ内 新潟県北蒲原郡中条町倉敷町 2 番28号 株式会社クラレ内 新潟県北蒲原郡中条町倉敷町 2 番28号 株式会社クラレ内 岡山県倉敷市酒津1621番地

明 細 書

1. 発明の名称

新規なヒドロキシスルホンおよびその製造方法 2. 特許請求の範囲

1. 一般式([)

(式中、Rは重換されていてもよいアリール 基を表わす)

で示されるヒドロキシスルホン。

- 2. Rが低級アルキル基で置換されていてもよ いアリール基を表わす請求項1記載のヒドロ キシスルホン。
- 3. 一般式(11)

$$CH_{5}SO_{2}R$$
 (I)

(式中、 R は 置換されていてもよい アリール 基を表わす)

で示される化合物と 2,2,6 - トリメチルシク

ロヘキサノンとを塩基の存在下に反応させる ことを特徴とする一般式(!)

(式中、Rは前記定義のとおりである)

で示されるヒドロキシスルホンの製造方法。

3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は一般式(1)

(式中、 B は 値換されていてもよいアリール基を 表わす)で示されるヒドロキシスルホン及びその 製造方法に関する。

本発明によって提供される一般式(I)のヒドロキシスルホンは医薬、飼料循加剤として使用されているピタミンA及びそのアセテート、ペルミテートに代表されるピタミンAのカルポン酸エステ

ルあるいはビタミンA酸の合成中間体であるβ-シクロゲラニルフェニルスルホンの合成中間体と して有用である。

参考文献,大寺ら,J.Org.Chem.,51,3834(1986)

大寺ら, J. Am. Chem. Soc., 106, 3670(1984)

[従来の技術]

従来、ダ・シクロゲラニルフェニルスルホンは 次に示すように3,7 - シメチル- 2,6 - オクタン エニルフェニルスルホン(通称:ゲラニルフェニ ルスルホン)を硫酸酸性条件下あるいは電解反応 条件下で閉環反応に附することにより製造される ことが知られている。

1) 特公昭 5 7 - 4 8 5 4 9 号公報

2) 字根山ら、Bull.Chem.Soc.Jpn., 58, 1859(1985)

本発明の他の1つの目的はその新規な化合物を製 造する方法を提供するにある。

α - シクロゲラニルフェニルスルホン

 β - シクロゲラニルフェニルスルホン,

r - シクロゲラニルフェニルスルホン

[課題を解決するための手段]

本発明によれば、上記の目的は、前記一般式(1) で示されるヒドロキシスルホンを提供することに よって達成され、また一般式(Ⅱ)

(式中、Rは前記定義のとおりである)で示され

[発明が解決しょうとする課題]

上記 1)の方法にしたがってβ-シクロゲラニル フェニルスルホンを製造する場合には、副生物と してその異性体であるα - シクロゲラニルフェニ ルスルホンが約20%程度生成する。また2)の方 **佐にしたがって製造する場合には、目的物である** β - シクロゲラニルフェニルスルホンに比較して 異性体であるα - シクロゲラニルフェニルスルホ ン及びァーシクロゲラニルフェニルスルホンが多 量に生成する。従ってピタミンA またはピタミン A酸合成の重要合成中間体であるドーシクロゲラ ニルフェニルスルホンを高純度で製造するには、 上記の反応混合物からクロマトグラフィーあるい は晶析等によって各々の異性体を分離する工程が 必要である。

しかして、本発明の1つの目的は安価にかつ容 易に入手できる工業原料から好収率でピタミンA またはピタミンA酸合成の重要中間体であるβ-シクログラニルフェニルスルホンを選択的に製造 することができる新規な化合物を提供するにある。

る化合物と 2,2,6 - トリメチルシクロヘキサノン を塩基の存在下に反応させることを特徴とする一 般式(1)で示されるヒドロキシスルホンの製造方 法を提供することによって達成される。

上記の一般式 (I) 及び一般式 (II) におけるRを 詳しく説明する。Rは置換されていてもよいアリ ール基を表わし、ことで世典基としては、例えば、 メチル、エチル、i-プロピル、n-プロピル、 i-プチル、n-プチル、sec-プチル、t-ブ チルなどの低級アルキル器;メトキシエトキシ、 i - プロポキシ、n - プトキシ、1 - プトキシ、 t-プトキシなどの低級アルコキシ基:塩素、臭 業、ヨウ素などのハロゲン原子などがあげられる。 好滴な遺換基の例は低級アルキル基である。また 魔 換 基 は オ ル ト (o) 位 、 メ タ (m) 位 又 は ペ ラ (p) 位のいずれの位値にあってもよく、1個又は2個 以上の複数個であってもよい。憧険されていても よいアリール基の具体例にはフェニル基、 0 - ト リル基、m - トリル基、 p - トリル基、 p - エチ ルフェニル基、p-n-プロピルフェニル基、

p - 1 - プロピルフェニル甚、 p - n - プチルフェニル番、 2,4 - ジメチルフェニル茜、 p - メトキシフェニル番、 p - メトキシフェニル番、 p - クロルフェニル番、 p - プロムフェニル番などがあげられる。 これらのうち好通なものはフェニル番及び p - トリル番であり、 特に好通なものはフェニル番である。

の鎖状又は環状エーテルなどを単独又は混合して 用いることができる。反応は用いる塩基によって も異なるが、通常-100°~100℃、好ましく は-80°~50℃の温度範囲内で行なわれる。また 反応はヘリウム、窒素、アルゴンなどの不活性が ス努囲気下で行なうのが有利である。反応時間は 採用した塩基、溶媒、反応温度等によって変化す るが、例えばエチルマグネシウムクロリドのエー テル密液を使用してペンセン密媒中で約10~ 20℃で反応を行なり場合には約3時間で十分で ある。上記の方法で製造した一般式(II)で示され る有機金属化台物は単雌されることなく、そのま ま 2,2,6 - トリメチルシクロヘキサノンと反応さ せて一般式(I) で示されるヒドロキシスルホンを 製造することができる。この反応は一般的には上 記の方法であらかじめ製造した一般式(Ⅲ)で示さ れる有機金属化合物の中に 2,2,6~トリメチルシ クロヘキサノンを旅加することによっても達成さ れるが、舔加がこれと逆であっても一向に歪しつ かえない。なお 2,2,6 - トリメチルシクロヘキサ ライド(グリニャール試楽)などである。

一般式(II)で示される化合物と 2,2,6 - トリメチルシクロヘキサノンとの反応では、まず一般式(II)で示される化合物と上記の塩基の反応により一般式(III)

$$M - CH_2 - SO_2 R \qquad (II)$$

(式中、Rは前記定義のとおりであり、Mはりをあり、YはMgYであり、Yはハロケが遺される有機金属化台物が製造され、シウででは、MgYであり、Yはハロケが遺される有機金属化台物と2,2,6 ートリメチで派金属化合物と2,2,6 ートリンスが製造された。塩化台では、Mg メチでが製造されたがでは、塩塩にアンスが製造とは、Mg ででは、塩塩にアンのでは、一般ででは、一般ででは、一般では、Mg としては、Mg とは、Mg とに、アラン、ジオキサンなに、アトラにドロフラン、ジオキサンなに、アトラにドロフラン、ジオキサンなに、Mg とは、Mg とに、アトラにドロフラン、ジオキサンなに、Mg とは、Mg とに、アトラにドロフラン、ジオキサンない、アトラにドロフラン、メオキサンない、アトラにドロフラン、カナンをは、Mg とは、Mg とに、アトラにドロフラン、メオキサンない、アトラによりに対しては、Mg とは、Mg とは、Mg といい、Mg には、Mg には、Mg

ノンは無格媒で反応に用いることもできるが、例 ゑはヘキサン、ヘプタン、ベンセンなどの脂肪族 又は芳香族炭化水業; ジエチルエーテル、ジー1 - プロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオ キサンなどの鎖状又は環状エーテルなどの単独又 は混合溶媒に希釈して用いることもできる。反応 は通常-100°~100℃、好ましくは-50°~ 50℃の温度範囲内で行なわれる。また反応はへ リウム、湿素、アルゴンなどの不活性ガス雰囲気 下で行なうのが有利である。反応時間は採用した 反応温度などによって変化するが、10°~20℃ の温度範囲で反応を行なり場合には約3時間で十 分である。なお 2,2,6 - トリメチルシクロヘキサ ノンは通常前記の塩基1モルに対して 0.1~10 モルの量で使用されるが、この数値範囲は限定的 ではない。

- 殺式(II) で示される有機金減化台物と 2,2,6 - トリメチルシクロヘキサノンとの反応では一般 式(N)

$$OM SO_2R$$
 (N)

(式中、R及びMは前配足機のとおりである)で 示されるヒドロキシスルホンのリチウム又はマグ オシウム塩が生成するが、反応混合液から一般式 (1) で示されるヒドロキシスルホンの分離、回収 は常法にしたがって行なりことができる。例えば 該反応組合液を水、塩化アンモニウム水裕液、希 塩酸などに任いて、一般式 (N) で示されるヒドロ キシスルホンのリチウム又はマグネシウム塩を加 水分解して一般式(I)で示されるヒドロキシスル ホンに変換させたのち有機層を分離し、その有機 層に対して必要により水洗及び/父は無水焼酸ナ トリウムによる乾燥及び/おは慎圧条件下での容 媒の留去を行なったのち、一般式(1)で示される ヒドロキシスルホンを単離することができる。こ りして得られたヒドロキシスルホンは、クロマト グラフィー、再雑品などの精製手段に付すること により、さらに純度を高めることができる。かか

$$So_2R$$
 (V)

〔寒施例〕

以下、実施例により本発明をさらに具体的に説

る方法で製造することができる一般式(I)で示されるヒドロキシスルホンは文献に未収の新規な化合物である。

上記一般式(I)で示されるとドロキシスルホンの製造において出発原料として使用する一般式(II)で示される化合物はそれ自体公知の化合物であり、例えば一般式(II)においてRがフェニル基である化合物は安価を工業原料であるペンゼンスルホニルクロリドから次の方法により製造されることが知られている。

$$\begin{array}{c}
\left\langle \bigcirc \right\rangle - \operatorname{SO}_{2} \operatorname{CL} \frac{\operatorname{Na}_{2} \operatorname{SO}_{3}}{\operatorname{NaHCO}_{3}} \left\langle \bigcirc \right\rangle - \operatorname{SO}_{2} \operatorname{N}_{9} \xrightarrow{\left(\operatorname{CH}_{5} \operatorname{O} \right)_{2} \operatorname{SO}_{2}} \left\langle \bigcirc \right\rangle - \operatorname{SO}_{2} \operatorname{CH}_{3}
\end{array}$$

Org. Syn., Coll. Vol., 4 674 (1963)

また、2,2,6 - トリメチルシクロへキサノンはシクロへキサノンのメチル化反応により製造されることが知られている(J.Am.Chem.Soc., 71,4136(1949) を参照)。

上記一般式(1)で示されるヒドロキシスルホン は脱水反応に付すことにより一般式(V)

明する。

実施例1

ジェチルエーテル及びベンセンを減圧下に留去 して、枯槁な曲分 3.1 0 g を得た。この曲分をシ リカゲルカラムクロマトグラフィー(展開液、酢 酸エチル/ヘキサン= 3 / 7)に付すことにより 白色結晶 2.1 4 8 を得た。このものは下記に示す 機器分析アータにより(1 - ヒドロキシ - 2,2,6 - トリメチルシクロヘキサン - 1 - イル) - メチ ルフェニルスルホンであることを確認した。収率 7 8 %。

IR (7 η μ Δ) ν (cm⁻¹): 3 5 2 0 , 3 0 5 0 , 2 9 1 0 , 1 5 7 0 , 1 4 4 0 , 1 3 8 0 , 1 2 9 0 , 1 1 3 0 , 1 0 7 0 , 7 3 0 , 6 8 0

NMR $\delta_{\text{HMB}}^{\text{CDCL}_5}$: 0.65~2.15(m, 16H), 3.02~3.62 (m, 3H), 7.35~8.06(m, 5H)

FD-MS m / e: 296 (M⁺)

奥施例2

100mlの三ッロフラスコにフェールメチルスルホン1.568及びテトラヒドロフラン20mlをとった。次にこの俗族に、選業ガス雰囲気下でロープチルリチウムのヘキサン俗液(1.5 M)6.7mlを内温-20~-15℃で滴下し、さらにその温度で1時間撹拌した。次いで、この中へ2,2,6-トリメチルンクロヘキサノン1.308をテトラ

高速液体クロマトグラフィー分析条件

カラム: ケムコソルブ 5 Si, ø 4.0 × 3 0 0 mm 展開液: 酢酸エチル/ヘキサン= 5/95 検 出: UV (254 nm)

[発明の効果]

本発明の方法によれば上記の実施例から明らかなとおり安価にかつ容易に人手できる工業原料から好収率でかつ容易に一般式(I)で示されるヒドロキシスルホンを毀造することができる。また本

ヒドロフラン 5 ml に俗かした裕液を-20~-15 C で簡下した。滴下終了後-20~-15 C で 3 0 分間、 さらに室温下で 2 時間撹拌した。反応混合物を 5 %塩酸水 2 0 ml 中に任いで、ベンセン 5 0 ml で 2 固有機層を抽出した。有機層を合し、 1 % 炭酸水 素ナトリウム水俗液及び飽和食塩水で順次洗浄し たのち無水硫酸マグネシウムで乾燥した。

テトラヒドロフラン及びペンゼンを滅圧下に留去して、枯禍な油分 3.1 3 8 を得た。この油分をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開液;酢酸エチル/ヘキサン= 3/7)に付することにより白色結晶 2.3 0 8 を得た。このものの IR, NMR 及び M S スペクトルは、実施例 1 のそれと一致した。収率 8 4 %。

多考例

実施例 1 で得た(1 - ヒドロキシー 2,2,6 - トリメチルシクロヘキサン - 1 - イル) - メチルフェニルスルホン 2.00 8 及びピリジン 1 0 配を3 0 配のナス形フラスコにとり、均一密液としたの5裕温 - 10~-5℃で冷却した。次いでこの中に

発明の一般式(I)で示されるヒドロキシスルホンは上記の参考例から明らかなとおり好収率でかつ容易に、ピタミンA 父はそのカルボン酸エステルの合成中間体として有用なβ - シクロゲラニルアリールスルホンに誘導される。

等許出願人 株式 会社 クラレ 代 選 人 弁理士 本 多 堅